



2021年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
( J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0 )  
問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

### 精密再生洗浄事業における中国子会社の設立ならびに新工場建設に関するお知らせ

当社は、昨年12月に当社子会社の安徽富楽徳科技發展有限公司（以下、「FTSA」）の100%連結子会社として、半導体、FPD製造装置の部品の精密再生洗浄事業の中国華南地区における事業拡大を目的に、広東省広州市に新会社（広州富楽徳科技發展有限公司）を設立し、2021年1月20日に新工場を建設着工しております。本件はFTSAが深セン証券取引所創業板市場への上場を予定していることから、投資判断に与える影響を鑑み、既往開示と平仄をあわせ任意開示として事後開示するものです。

#### 記

#### 1. 設備投資の背景と目的

当社は2001年に中国上海において、半導体製造装置、FPD製造装置の部品の精密再生洗浄事業に参入して以来、天津、四川、大連、安徽へと順調に拠点を拡大して参りました。また、昨今の中国製造2025に伴う中国政府による中国国内の半導体メーカー育成、強化の中で、微細化、3D化等の先端投資に応じて半導体製造装置の部品の洗浄頻度と要求精度が上昇しており、大手半導体デバイスメーカー及びFPDパネルメーカー並びに同製造装置メーカー各社から当社に対し、洗浄工場の新規拠点の開設要請が来ておりました。

当社としては、顧客との関係強化と洗浄事業の更なる拡大を図れる好機と捉え、近年半導体やFPDパネルメーカーの進出が著しい広東省に6拠点目の精密再生洗浄工場を開設することとしました。今回の工場新設により、華南地区をカバーすることで、精密再生洗浄事業の更なる市場シェアの拡大と収益力を向上が見込まれるとともに、中国における精密再生洗浄業界のトップのサービスプロバイダーとしての地位をさらに強固なものにすることが期待されます。

#### 2. 新設会社の概要

(1) 名 称	広州富楽徳科技發展有限公司
(2) 所 在 地	中国広東省広州市広州開発区内氷河経済区
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢 漢
(4) 事 業 内 容	半導体、液晶向け高純度プロセスツールパーツ洗浄サービス
(5) 登 録 資 本 金	6,000万人民元（約10.2億円、1人民元=16.95円）
(6) 設 立 年 月 日	2020年12月22日
(7) 大株主及び持ち株比率	安徽富楽徳科技發展有限公司（当社連結子会社）100%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が出資している安徽富楽徳科技發展有限公司が100%出資の孫会社となります。
	人的関係	当社代表取締役の賀賢漢が当該会社の董事長を兼務します。
	取引関係	記載すべき取引関係はありません。

### 3. 新工場の概要

(1) 所在地	中国広東省広州市広州開発区内氷河経済区
(2) 敷地面積	約 13,900 平米
(3) 投資形態	土地、建物とも自己名義
(4) 生産品目	半導体、液晶向け高純度プロセスツールパーツ洗浄サービス
(5) 投資金額	約 300 百万元（設備投資及び運転資金を含みます。） （約 50.8 億円、1 人民元=16.95 円）
(6) 資金調達方法	自己資金及び借入れによる。
(7) 稼働開始日	2022 年以降

### 4. 今後の見通し

当社の 2022 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

#### <精密再生洗浄事業関連リリース一覧（2019年以降）>

開示日	対象子会社名	略称	表題
2021/5/21	四川富楽徳科技發展有限公司	FTSS	「精密再生洗浄事業における中国子会社の設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ」
2021/5/21	安徽富楽科技發展股分有限公司	FTSA	「(開示事項の変更) 中国子会社の科创板市場(スター・マーケット)への上場準備に関するお知らせ」
2020/8/14	安徽富楽科技發展股分有限公司	FTSA	「中国子会社の科创板市場(スター・マーケット)への上場準備に関するお知らせ」
2019/12/11	安徽富楽科技發展股分有限公司	FTSA	「特定子会社の増資(開示事項の変更)及び商号変更に関するお知らせ」
2019/7/17	安徽富楽科技發展股分有限公司	FTSA	「中国子会社の組織再編並びに特定子会社の異動に関するお知らせ」

#### <用語説明> ~PVDとCVD法について~

1. PVD (Physical Vapor Deposition) : 物理的気相成長と言われる半導体製造プロセスの一つで、真空中で金属の原子や分子を物質の表面に高速でぶつけることでウエーハに膜を堆積させる方法。
2. CVD (Chemical Vapor Deposition) : 化学的気相成長と言われる半導体製造プロセスの一つで、物質表面あるいは気相での化学反応によりウエーハの表面に膜を堆積させる方法。
3. ETCH : 半導体製造プロセスの一つで、ウエーハ上に酸化膜等の薄膜を形成し、フォトリジストを塗布してパターン露光後に不要な薄膜を除去する方法。

[ 別紙 ]

< 着工式の様子 >



< 新工場完成予想図 >

